

レーザ光応用による高度な オプトメカトロニクス 製品の開発設計

エーエル ティー 株式会社



代表取締役
高野 裕

東京都
練馬区豊玉南1-21-10

1992年(平成4年)設立
03-5946-7336

<http://www.alt.co.jp/>

レーザビーム走査関連応用技術をコアに、「測れないものを測る」事を追求し、光MEMSの計測システムや幅広い産業分野で使用される計測用のレーザ光源を開発製造販売。

業界標準の光MEMS計測システム

最先端技術の光スキャンMEMSデバイスは、開発現場では研究者が独自の計測方法で検証実験を行っていたが、計測システムとしての完成度が低く、計測に時間がかかるとともに、データの信頼性が得にくかった。

独自の特許技術により高速振幅計測を可能にし、開発時間の短縮を実現するとともに、事実上の業界標準として実績を上げている。

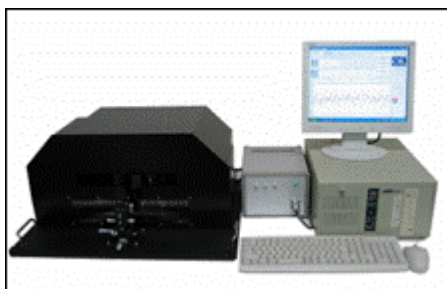
計測用レーザ光源ユニット

①デガウス光学系による均一な光量分布が得られる5 μ m \times 20mm微細線レーザライン光源、
②ビームを走査することなく360°方向にリング状にレーザ光を照射できるレーザリング光源、
③MEMSスキャナ、ポリゴンスキャナ、ガルバノスキャナを使用したレーザスキャン光源等の特殊な高精度の計測用光源を開発供給している。

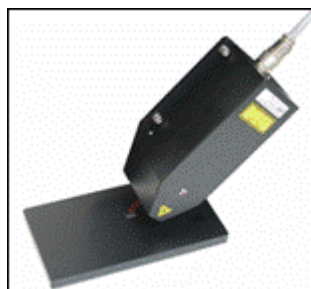
オプトメカトロニクス製品の開発設計

新規開発及び量産に対し、製品化技術調査、原理確認、試作の各段階の対応を行い、OEM供給での量産対応をおこなっている。

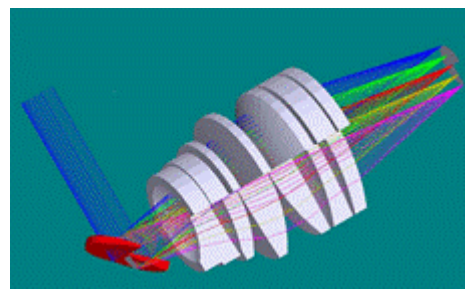
光学応用機器開発に関しては高度な光学シミュレーションを実施し、機構設計、電気設計、ソフト設計の総合的な設計技術により、レーザレンジファインダーや3次元計測、ミクロンオーダーのパーティクル検出、トンネル壁面や路面の状況検査など高度なユニットの開発に貢献している。



光MEMS計測システム



計測用レーザ光源ユニット



製品の開発イメージ